

CONTENTS

電子月刊

IC製程技術專輯  
IC Process Technology

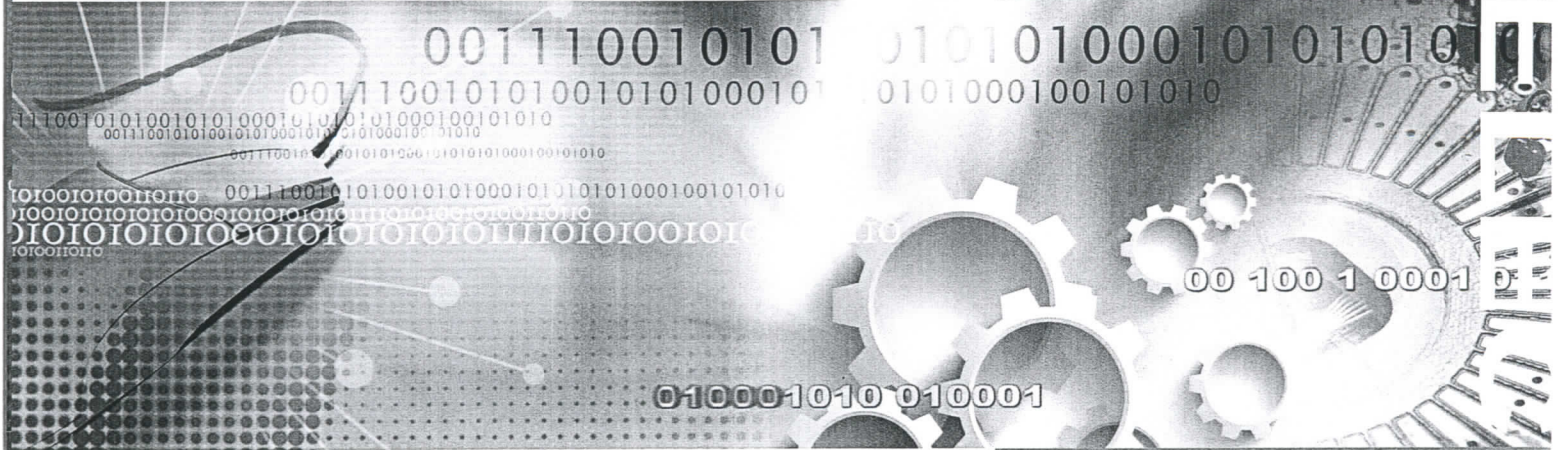
2014年9月號 · No.230

IC製程技術專輯 · 崔秉鉞 主編

- 44** IC製程技術專輯前言  
崔秉鉞
- 46** 極紫外光微影光源的發展現況  
許博淵
- 56** 極紫外光(EUV)光阻之發展與挑戰  
陳政宏、張書豪、吳瑞慶、簡銘進、  
簡上傑、嚴濤南
- 80** 奈米壓印微影技術  
周智超、陳柏宇、賴詩韻、朱念平
- 94** 電子束檢測技術晶圓良率提升的幕後功臣  
厲明瑞

下轉第4頁

# CONTENTS



本刊圖文未經同意，不得轉載或公開傳送！

## 專欄

主被動元件

### 108 新型非對稱步階式阻抗共振器的設計與應用

楊茹媛、藍祥文、許哲維、洪政源

## 專欄

3D IC

### 120 光罩對準曝光機製程技術設備簡介

古志鵬、鍾武雄、張明宗

### 130 先進晶圓接合製程膠材之回收系統

賴耀梓、呂俊霖、張香鈺

## 人生偶拾

### 140 穿越時空看穿矛盾

黃博治

## PCB技術小百科

### 142 功能性與連結性主機板構裝

翁敏航

## 社內消息

廣告部

25 廣告索引

發行部

79 日文JIS手冊訂閱消息

139 日文科技刊物訂閱消息

144 國際專業期刊訂閱消息

145 劃撥單

編輯部

26 讀者意見調查表

43 2014年10月專輯主題說明

